

## イオンプレーティング装置 IC-1500



イオンプレーティング装置IC-1500は、油回転ポンプ・油拡散ポンプ・液体窒素トラップの排気系で構成され、粗引開始後5分で $\times 10^{-4}$ Pa台まで到達します。EB方式により、あらゆる誘電体や金属の成膜に対応することが可能です。また直流安定化電源(バイアス用)、加熱機構、水晶式膜厚計も標準搭載しておりますので、より密着性の高い膜&膜厚精度の高い膜を成形することも可能です。

### イオンプレーティング装置IC-1500仕様

- 到達圧力  $\times 10^{-5}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 排気速度  $\times 10^{-4}$ Pa台迄本引開始後5分以内※常温・無負荷・脱ガス完了・液体窒素使用時
- 真空室径  $\phi 500\text{mm} \times 650\text{mmH}$  SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子衝撃方式(EB方式)  
電子銃最大投入電力:5KW  
ルツボ容量:2.9ml  
ルツボ个数:4個  
ビーム偏向角:225度  
電源出力電圧:DC-4~-10KV  
電源出力電流:DC0~500mA
- 基板回転 モーター直接駆動方式  
回転数:0~40rpm
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5KW $\times 2$ 式  
常温~300°C迄昇温可能  
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:1200L/min[60Hz]  
油拡散ポンプ:3000L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/メタル電離真空計
- バイアス機構DC0~-1KV DC0~0.5A 直流安定化電源 1台
- プラズマ機構RF電源 13.56MHz 600W 自動マッチング 1台
- 操作方法 自動/手動選択可能
- ガス機構 マスフローコントローラ $\times 1$ 式
- ユーティリティ電気:AC200V三相15KVA  
冷却水:17L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25°C以下循環  
圧縮空気:0.5MPa以上